云 南 植 物 研 究　1995; **17** (2): 231—232
**Acta Botanica Yunnanica**

# 香港新记载的三种蕨类植物

苏美灵
(香港浸会学院生物系, 香港九龙窝打老道 224 号)

# NEW RECORDS OF FERNS IN HONG KONG

SU Mei-Ling(M.L.So)
(*Biology Department, Hong Kong Baptist College,* 224 Waterloo Road Hong Kong)

**关键词**　中华刺蕨, 细口团扇蕨, 南洋假脉蕨, 新记载
**Key words**　*Egenolfia sinensis, Sphaerocionium nitidulum, Crepidomonas bipunctatum,* New record

香港虽然只不过是一个面积 1074 $km^2$ 的小地方, 但植物种类繁多。本地生的维管束植物已录得 1996 种，新记录时有发现。香港地势多山，山区占总面积约四分之三。由于大片郊区早已被指定为郊野公园，严禁任意采摘，所在在这 20 年间，各郊区仍能保持不同的植物种类。新界的大埔坳自然保护区更是一片独特的地方，因为它是唯一未受战争影响的树林，林内有多条山溪，以致在干旱的冬天, 也能保持固定的湿度。

根据香港渔农处所出版的《香港植物名录》蕨类植物有 180 种。H.H.Edie [1] 只提及 175 种，但亦特别指出某些种已多年未见过，可能早已不存在。在过去一年多的实地考察中，作者只能找到其中的 141 种，不过却发现了新记载的 3 种蕨类。标本存香港浸会学院生物系标本室内。

**中华刺蕨　Egenolfia sinensis**（Bak.）Maxon

根据 Edie [1] 记载，本港只有 *Egenolfia appendiculata*（Willd.）J. Sm.，此种在一些溪石旁阴暗的地方均可以发现，但仍属于少见的蕨。但中华刺蕨则发现于大埔坳 200 m 高的山溪旁一块巨石下的阴暗处，并且只有两棵。

*Egenolfia sinensis* 和 *Bolbitis subcordata* 甚相似，唯一不同乃后者顶生羽片成一尖长的三角形，但前者之顶部有 8 对则羽片。(So 93325)

**细口团扇蕨　Sphaerocionium nitidulum**（v.d.B）Iwat.

本种原被分类为 *Trichomanes nitidulum* v.d.B.PL.Jungh. Copeland [2] 在 1938 年曾对此属进行一次大修正，将之改为 *Microtrichomanes nitidulum*（v.d.B.）Copel.其后 K. Iwatsuki [3,4] 在他对膜叶蕨科的分类详细分析 *Microtrichomanes* 内所有种类, 认为此种应属于 *Sphaerocionium.*

本种附生在阴湿的岩石上, 与其它苔藓植物混生。(So 93325 F，So 93131F)

**南洋假脉蕨　Crepidomonas bipunctatum**（Poir.）Copel.

本种是在高 600 m 瀑布旁阴湿岩石上生长，十分罕见，在其它同样生境未有发现。(So 94822 F)

1994-11-10 收稿

**结语**

虽然香港人口密集，可幸仍有大片地方被列入自然保护区，动植物可以得到足够的保护，相信仍有一些微细型蕨类植物等待发掘。

**致谢** 文中细口团扇蕨和南洋假脉蕨标本的鉴定，得到菲律宾大学标本室何振忠的指导和帮助。中华刺蕨的鉴定得到中国科学院华南植物研究所吴兆洪教授指导。

## 参 考 文 献

〔1〕Edie H H. Ferns of Hong Kong. Hong Kong University Press. 1978.

〔2〕Copeland E B. Genera Hymenophyllaceae. *Phil J Sc*, 1938, **67:** 1—110.

〔3〕Iwatsuki K. Studies in the systematics of Filmy Ferns I. A Note on the Identity of *Microtrichomanes*. *Ferns Gaz*, 1975, **11:** 115—124.

〔4〕Iwatsuki K. Studies in the systematics of Filmy Ferns Ⅵ. The Genus *Sphaerocionium* in Asia and Oceania. *J Fac Sci University Tokyo Sect*. Ⅲ, 1982, **13:** 203—215.

* * * * * * * * * *

**(上接 220 页)**

11. 质谱须注明所用的方法，如(EIMS, CIMS, GC-MS, FABMS 等)及离解能，只须给出分子离子峰及重要的特征碎片峰(相对强度)，如:EIMS(70eV m／z(%): 386[$M^+$](36), 368$[M-H_2O]^+$ (100), 275$[M-111]^+$(35) 等。高分辩质谱(HRMS)若有必要可多给一些信息。

12. 紫外光谱表示法，如 UV$\lambda_{max}^{EtOH}$nm(lgε): 203(4.17)。

13. 红外光谱表示法，如 IR$\nu_{max}^{KBr}$$cm^{-1}$: 1740。官能团的指定放在圆括号内，如: 1740(>C=O)。若要标明吸收带的强度，则采用以下缩写符号: w (弱), m (中等), v (可变), s (强), vs(很强)。

14. 有机化合物和无机化合物及有关的缩写符号须规范化(参考 CA)，如氘代溶剂 $CDCl_3$, DMSO-$d_5$, $D_2O$, pyridine-$d_5$ 等。常见化学试剂在文中均以化学符号表示，如: MeOH, EtOH, n-BuOH, PrOH, iso-PrOH, PhOH(苯酚), petrol (石油醚), $CHCl_3$, $CCl_4$, $C_6C_6$, $Et_2O$, $Me_2CO$, HOAc, EtOAc, THF, $Ac_2O$, NaOMe, $CH_2N_2$, $HCO_2H$(甲酸), TCA(三氯乙酸), TFA(三氟乙酸), NaOAc, NaOH, HCl, $H_2SO_4$, $CO_2$, $H_3BO_3$, $NH_3$, $N_2$ 等。

15. 制备薄层析须注明(1) 薄层厚度; (2) 样品的量; (3) 确定带的方法; (4) 从吸附剂上洗脱下化合物所用的溶剂。特殊 TLC 的吸附剂须注明，如: $AgNO_3$-硅胶(1∶9)。

16. 气相色谱 (GC)须注明检测器(FID,EC 等)，载气及流速，操作温度，柱子情况等。

17. 高压液相(HPLC) 须注明(1) 柱子情况，如大小、型号; (2) 压力及溶剂; (3) 检测方法，如 UV 或折射率。

18. X-衍射只须给出立体结构图(最好有键长)及必要的数据，详细记录可指明在什么地方储存。